



(China)

EVG Launches New Multifunctional Micro-Nano Imprinting Solution for High-Volume Optical Component Manufacturing – January 26, 2022

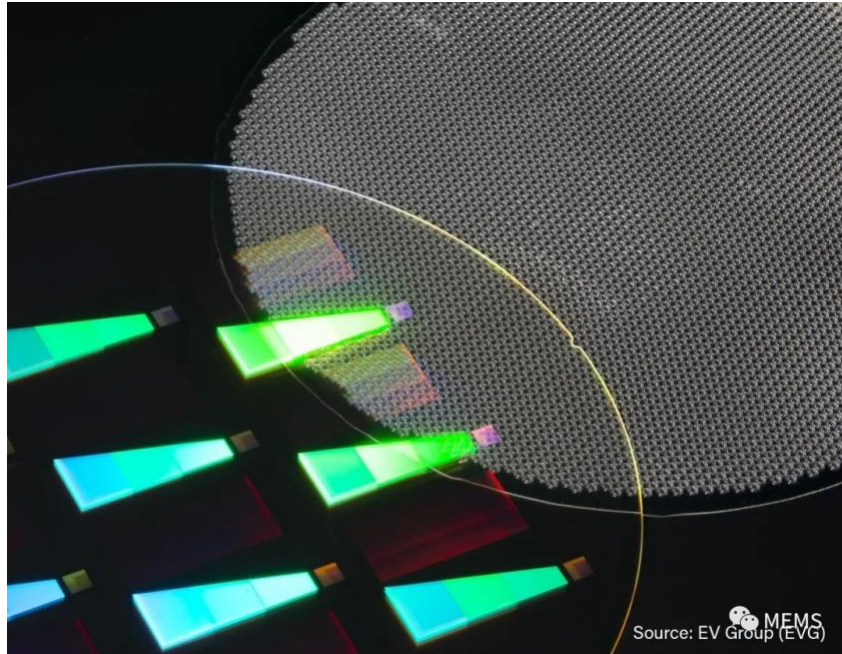
面向大批量光学元件制造，EVG推出全新的多功能微纳米压印解决方案



EVG@7300 SmartNIL@纳米压印和晶圆级光学系统

据麦姆斯咨询报道，MEMS、纳米技术及半导体市场晶圆键合和光刻设备领先供应商EV Group (EVG)，近日推出了EVG@7300自动化SmartNIL@纳米压印和晶圆级光学系统。EVG7300是EVG当前最先进的解决方案，在单个平台上结合了多种紫外工艺能力，包括纳米压印光刻 (NIL)、透镜成型和透镜堆叠 (UV键合) 等。

这款为产业应用做好准备的多功能系统，旨在满足各种先进新兴应用的研发和生产需求，包括微米和纳米图案化以及功能层堆叠技术，例如，晶圆级光学器件 (WLO)、光学传感器和投影器、汽车照明、用于增强现实 (AR) 头戴设备的波导元件、生物医疗器件、超透镜和超表面以及光电子学应用等。EVG7300支持最大12英寸晶圆，具有高精度对准、先进工艺控制和高通量等优势，可以满足各种自由曲面和高精度纳米/微米光学元件的大批量制造需求。



EVG技术总监Thomas Glinsner表示：“凭借在纳米压印技术领域的20多年积累，EVG将继续开拓这一重要领域，开发创新的解决方案，以满足客户不断变化的需求。最新推出的纳米压印解决方案EVG7300，将我们的SmartNIL全场压印技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合在一起，打造了这款最先进的系统，具有市场上最精确的对准和工艺参数控制，为我们的产业客户提供了前所未有的灵活性，以满足其研究和生产需要。”

EVG7300系统既是一款独立工具，也可作为EVG的HERCULES®NIL全集成UV-NIL跟踪解决方案中的集成模块，可添加额外的预处理步骤，如清洁、抗蚀涂层、烘焙或后处理，以优化特定的工艺需要。通过结合对准平台改进、高精度光学、多点间隙控制、非接触间隙测量和多点力控制等技术，该系统实现了业界领先的对准精度（低至300 nm）。

EVG7300是一款高度灵活的平台，提供三种不同的工艺模式（透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印），并支持从150 mm到300 mm的衬底尺寸。EVG7300凭借印戳和晶圆的快速加载、快速对准光学元件、高功率固化以及小巧的占位面积，这款高效平台能够充分满足行业对新兴WLO产品的制造需求。

产品供应

EVG目前已开始接受该系统的订单，现在可以在EVG总部的EVG NILPhotonics®技术中心进行产品演示。有关EVG7300自动SmartNIL纳米压印和晶圆级光学系统的更多信息，请访问EVG官网。

关于EV

Group

EV Group (EVG) 是半导体、MEMS、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造设备和工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/纳米压印光刻 (NIL) 和计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EVG成立于1980年，致力于为全世界各地的全球客户和合作伙伴提供服务和支持。

延伸阅读：

《AR/VR/MR光学元件和显示器-2020版》

<https://www.eet-china.com/mp/a107603.html>